

光刻胶紫外正性/负性光刻胶 HSQ Fox-15/16

产品名称	光刻胶紫外正性/负性光刻胶 HSQ Fox-15/16
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

产品	型号	光源	类型	分辨率	厚度 (um)	适用
厚胶 Thick Resist	SU-8 GM10xx系列	g/h/i-Line	负性	0.1um	0.1-200	具有
	SU-8 Microchem g/h/i-Line	g/h/i-Line	负性	0.5um	0.5-650	具有
	NR26-25000P	g/h/i-Line	正性	1um	1—30	可用于选择性电镀电镀，深硅刻蚀等工艺。
电子束光刻胶	NR26-25000P	g/h/i-Line	负性	20-130	厚度大，相对容易去胶。	适用
	SU-8 GM1010	电子束	负性	100nm	0.1-0.2	可用
	HSQ	电子束	负性	6nm	30nm~180nm	分辨率
	XR-1541-002/004/006					
	HSQ Fox-15/16	电子束	负性	100nm	350nm~810nm	分辨率
	PMMA(国产)	电子束	正性	\	\	高分
	PMMA (进口)	电子束	正性	\	\	束光
薄胶	型号	光源	类型	分辨率	厚度 (um)	适用
	S18xx系列	g-Line	正性	0.5um	0.4-3.5	较常
	SPR955系列	i-Line	正性	0.35um	0.7-1.6	进口
	BCI-3511	i-Line	正性	0.35um	0.5-2	国产
	NRD6015	248nm	负性	0.2um	0.7-1.3	国产
Lift off光刻胶	型号	光源	类型	分辨率	厚度 (um)	适用
	KXN5735-LO	g/h/i-Line	负性	4um	2.2-5.2	负性
	LOL2000/3000	g/h/i-Line	/	NA	130nm-300nm	非Lift off

光刻胶配套试剂	ROL-7133	g/h/i-Line	/	4um	2.8-4	负性
	品名	主要成分	包装	应用	/	/
	正胶显影液	TMAH 2.38%	4LR/PC	正胶显影液	/	/
	正胶稀释剂	PGMEA	4LR/PC	稀释剂	/	/
	SU8 显影液	PGMEA	4L/PC	显影SU8光刻胶	/	/
	RD-HMDS	HMDS	500ml/PC	增粘剂	/	/
	OMNICOAT	见MSDS	500ml/PC	SU-8增粘剂	/	/